Research Center for Photovoltaics MBE法による0.7 eV帯InGaAs 太陽電池の高性能化

石塚優希^{1,2} 大島隆治¹ 岡野好伸² 菅谷武芳¹ 1産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター 先進多接合デバイスチーム <mark>2東京都市大学 総合理工学研究科 情報専攻</mark>



- 光強度が増大し半値幅が低減した。 2°A基板を用いることにより、ステップフロー成長をより促進
- できることを明らかにした。
- 2°Aかつ490°Cで成長したInGaAsセルは、MBE法を用いた InGaAsセルで最も高い変換効率12.3%、かつ最も小さい $W_{\rm oc}$ = 0.37 Vが得られた。

本研究の一部は、国立研究開発法人NEDO「超高効率・低コスト III-V化合物太陽電池モジュールの研究開発」により行われた。

[6] F. Chancerel et al., Sol. Energy Mater. Sol. Cells 195, 204 (2019). [7] R. Oshima et al., Proc. 43rd IEEE PVSC, 2354 (2016).